

● レイテックスの装置戦略

次の飛躍に向け開発力を強化 デバイス向けでは液浸を狙う

三井金属からSiウェーハ検査事業を買収

レイテックスは、次なる飛躍を目指して様々な布石を打つとともに、体制の整備に注力している。

Siウェーハの検査関連では、三井金属からSiウェーハ検査装置事業を買収した。すでに、LSTDスキャナ「MO-601」、BMDアナライザ「MO-441」としてラインナップに加えている。MO-601は、Siウェーハの表面異物や荒れ、表層近傍の欠陥などを識別・検査する装置。ラスカスキャン方式により計測条件を一定にしている他、散乱像を同時に観察できるイメージ機能を搭載、欠陥、異物、ヘイズを識別して計測できる。欠陥検出感度は40nm径、異物検出限界は60nm径。一方、MO-441は、Siウェーハ内部の欠陥密度を測定する装置で、レーザをSi結晶内に入射し、欠陥部分からの散乱光を画像化する。この散乱像から欠陥密度、欠陥密度の動径分布、DZ幅（無欠陥層の厚さ）を自動で出力する。エッチングすることなくSiウェーハ内部の欠陥を検出を可能にした。感度は数十nm、検出時間は1視野/5秒。視野は500×500μm～500×5000μm。いずれもレーザを用いた検査・測定装置だが、レイテックスのコア技術に近い部分が多い。このため、製品ラインナップが増えたことだけでなく、これらの技術を従来製品にも取り入れていくとともに、次世代製品の開発にも活用していく。

また、2007年4月には、ナノシステムソリューションズ（NSS）を完全子会社化した。以前より、一部装置の開発や生産を委託するなど、密接な関係にあった。レイテックスは製品ラインアップの拡充に伴い開発力の一層の強化が必要になっていた。一方、NSSは独自のテレセントリック光学技術は高い評価を受けているが、ビジネス的には苦戦しており、赤字が続いていた。このため、レイテックスの子会社となり、新たにスタートすることになった。すでに、NSSの社員はレイテックスの本社に移動している。

NanoPro NP2を2番目の柱に

現在、大手Siウェーハメーカーは300mmウェーハの増産を急ピッチで進めており、検査装置に関するニーズも引き続き強い。デファクトとなった「EdgeScan」に続く大きな柱へと育成しようとしているのが、トポグラフィ測定装置「NanoPro NP2」だ。米KLA-Tencor

から買収した事業・装置で、Siウェーハの両面を同時に平坦度やナノトポグラフィ、ロールオフなどを測定できる。性能およびスループットのブラッシュアップに若干手間取っていたが、ユーザー先での評価試験にもパスした。タイミング的にも300mmウェーハの増産に伴う測定装置の選定にぎりぎり間にあった。ユーザーからの期待も大きい装置であり、今後も継続して装置・技術の改良・改善を実施し、さらなる拡販を目指していく。

デバイス向けでは、液浸リソグラフィへの導入を狙っている。液浸露光は若干立ち上がりが遅れているが、同社では本格量産がいつ始まっても対応できるように、着実にデータの収集やインテグレーションを進めている。

Siウェーハ向けではほぼフルラインナップが揃った。今後も技術的優位性を生かした製品作りを進めていくとともに、使い勝手の向上などにも取り組んでいく考えだ。

レイテックスの会社概要

設立：1988年7月19日
 代表者：高村 淳
 資本金：10億7220万円
 売上高：
 2005年度実績 48億7500万円
 2006年度見込 59億900万円
 事業内容：ウェーハ自動検査装置の製造・販売など



代表取締役社長 高村 淳氏